

488696-2026 - Iomaíocht

Éire – Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) – LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

OJ S 134/2026 15/07/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras - Fógra maidir le hathrú Soláthairtí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Education Procurement Service (EPS)

R-phost: info@educationprocurementservice.ie

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Comhlacht dlí phoiblí

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

Cur síos: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Aitheantóir an nós imeachta: a024c275-b92f-48d9-83b8-52aa370660c8

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): South-East (IE052)

Tír: Éire

2.1.3. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 3 300 000,00 EUR

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

2.1.5. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Líon uasta na luchtóg ar féidir le tairgeoir amháin tairiscintí a chur isteach ina leith: 4

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Plasma Etcher ,Silicon ,Dielectrics

Cur síos: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Aitheantóir inmheánach: 1

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): South-East (IE052)

Tír: Éire

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 48 Míonna

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7. Soláthar straitéiseach

Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Béarla

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair (nó codanna díobh) ar fáil go neamhoifigiúil: Béarla

Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Béarla

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 180 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Áit: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní fios go fóill

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: The High Court of Ireland

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair: Education Procurement Service (EPS)

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: The High Court of Ireland

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Education Procurement Service (EPS)

Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Luchtóg: LOT-0002

Teideal: Plasma Etcher ,Metals ,Piezoelectrics

Cur síos: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Aitheantóir inmheánach: 2

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): South-East (IE052)

Tír: Éire

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 48 Míonna

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7. Soláthar straitéiseach

Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Béarla

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair (nó codanna díobh) ar fáil go neamhoifigiúil: Béarla

Spríoc-am chun eolas breise a iarraidh: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Béarla

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ceadmhach

Spríocdháta chun tairiscintí a fháil: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 180 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Áit: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní fios go fóill

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: The High Court of Ireland

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair: Education Procurement Service (EPS)

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: The High Court of Ireland

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Education Procurement Service (EPS)

Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí: Education Procurement Service (EPS)

5.1. **Luchtóg: LOT-0003**

Teideal: Plasma Etcher ,Slow and Controllable Rate ,Atomic Layer Etch for Silicon , Dielectrics
Cur síos: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Aitheantóir inmheánach: 3

5.1.1. **Cuspóir**

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

5.1.2. **An áit feidhmíochta**

Forinn tíre (NUTS): South-East (IE052)

Tír: Éire

5.1.3. **Fad measta**

Fad ama: 48 Míonna

5.1.5. **Luach**

Luach measta gan CBL a áireamh: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. **Eolas ginearálta**

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7. Soláthar straitéiseach

Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Béarla

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair (nó codanna díobh) ar fáil go neamhoifigiúil: Béarla

Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Béarla

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 180 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Áit: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní fios go fóill

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: The High Court of Ireland

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair: Education Procurement Service (EPS)

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: The High Court of Ireland

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Education Procurement Service (EPS)

Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí: Education Procurement Service (EPS)

5.1. **Luchtóg: LOT-0004**

Teideal: Plasma Deposition ,PECVD

Cur síos: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Aitheantóir inmheánach: 4

5.1.1. **Cuspóir**

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

5.1.2. **An áit feidhmíochta**

Foroinn tíre (NUTS): South-East (IE052)

Tír: Éire

5.1.3. **Fad measta**

Fad ama: 48 Míonna

5.1.5. **Luach**

Luach measta gan CBL a áireamh: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. **Eolas ginearálta**

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7. **Soláthar straitéiseach**

Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.9. **Critéir roghnúcháin**

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. **Doiciméid soláthair**

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Béarla

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair (nó codanna díobh) ar fáil go neamhoifigiúil: Béarla

Spríoc-am chun eolas breise a iarraidh: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Béarla

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ceadmhach

Spríocdháta chun tairiscintí a fháil: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 180 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Áit: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní fios go fóill

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: The High Court of Ireland

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair: Education Procurement Service (EPS)

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: The High Court of Ireland

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Education Procurement Service (EPS)

Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí: Education Procurement Service (EPS)

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Education Procurement Service (EPS)

Uimhir chlárúcháin: IE 6609370 G

Seoladh poist: Castletroy Limerick

Baile: Limerick

Cód poist: V94 DK53
Foroinn tíre (NUTS): Mid-West (IE051)
Tír: Éire
R-phost: info@educationprocurementservice.ie
Teil.: 000
Seoladh idirlín: <https://www.educationprocurementservice.ie/>
Próifíl an cheannaitheora: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht

Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: The High Court of Ireland
Uimhir chlárúcháin: The High Court of Ireland
Roinn: The High Court of Ireland
Seoladh poist: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7
Baile: Dublin
Cód poist: D07 WDX8
Foroinn tíre (NUTS): Dublin (IE061)
Tír: Éire
R-phost: HighCourtCentralOffice@courts.ie
Teil.: +353 1 8886000

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

8.1. ORG-0003

Ainm oifigiúil: European Dynamics S.A.
Uimhir chlárúcháin: 002024901000
Roinn: European Dynamics S.A.
Baile: Athens
Cód poist: 15125
Foroinn tíre (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)
Tír: An Ghréig
R-phost: eproc-esender@eurodyn.com
Teil.: +30 2108094500

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

10. Athraigh

Leagan den fhógra roimhe seo atá le hathrú
:
46fee6a2-f409-4cd6-80db-618a50fcc925-01
An phríomhchúis leis an athrú
:
Faisnéis nuashonraithe

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 7a2067c1-5ebe-49f4-b53b-0f9595ac5fa3 - 02

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 13/07/2026 16:03:29 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Béarla

Uimhir foilseacháin an fhógra: 488696-2026

Uimhir eagráin IO S: 134/2026

Dáta foilsithe: 15/07/2026